PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

63-228433

(43)Date of publication of application: 22.09.1988

(51)Int.CI.

G11B 7/24

B41M 5/26

(21)Application number : 62-061604

(71)Applicant: MATSUSHITA ELECTRIC IND CO

LTD

(22)Date of filing:

17.03.1987

(72)Inventor: OTA TAKEO

UCHIDA MASAMI KODERA KOICHI

MATSUBARA KUNIHIRO

(54) OPTICAL INFORMATION RECORDING, REPRODUCING AND ERASING MEMBER (57)Abstract:

PURPOSE: To obtain a recording member having high sensitivity and stabilized cycle characteristics by using a GeTe-Sb2Te3-excess Sb mixture.

CONSTITUTION: When Sb2Te3 having 622° C m.p. is into a thin film, the film has recording action by conversion into an amorphous phase and crystallization but the film has a low blackening (accompanied by crystallization) temp. and low thermal stability. By mixing the Sb2Te3 with GeTe having a higher m.p. and 725° C Tm, the crystallization temp. is raised and superior thermal stability is provided. An Sb2Te3-GeTe film is, however, liable to cause the deterioration of signal quality in the cycle of heat recording (conversion into an amorphous phase) and erasing (crystallization) or in the cycle of recording and erasing in the reverse mode due to the phase separation of GeTe from Sb2Te3. I order to prevent the phase separation and to improve the cycle characteristics, excess Sb is added and an Sb2Te3-GeTe-excess Sb mixture is used.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C): 1998,2000 Japanese Patent Office

⑩日本国特許庁(JP)

の特許出額公開

⑩公開特許公報(A)

昭63 - 228433

Mint Cl.

識別記号

庁内整理番号

@公開 昭和63年(1988)9月22日

7/24 G 11 B B 41 M 5/26 A-8421-5D X-7265-2H

審査請求 未請求 発明の数 1

60発明の名称

光学情報記録再生消去部材

顧 昭62-61604 创特

昭62(1987)3月17日 ❷出

威 夫 8 @発 明 者 太 Ħ 正 美 内 明 者 仍発 宏 寺 @発 明 者 . 小 弘 原 邦 松 明 @発 松下電器産業株式会社 の出 願 人 敏男 弁理士 中尾 00代 理 人

大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器產業株式会社内 大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器產業株式会社内 大阪府門真市大字門真1006番地 大阪府門真市大字門真1006番地

大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器産業株式会社内 松下電器產業株式会社内

外1名

1、発明の名称

光学情報記録再生消去部材

2、特許請求の範囲

- (1) レーザ光等の照射により、熱的に状態を変化 させる薄膜をGeTeと Sb₂Te₃ からなる混合体 に、過剰のSbを含ませて基板上に形成してなる 光学情報記録再生消去部材。
- (2) 過剰の Sb の量を、+Sb a t 多とし、 Sb2Te3 mo8多との比を、10<+Sb at多/ Sb2Te3 mol%<30に選ぶことを特徴とする特 許請求の範囲第1項記載の光学情報記録再生消去 部材。
- (3) GeTe の量を、O.5 < GeTe mo 6 多/Sb2 Te3 mo 6 多 <2.0 に選ぶことを特徴とする特許請求の範囲第 1 項記載の光学情報記録再生商去部材。
- (4) あらかじめ葢板の上に酵電体層を形成し、そ の上に、GeTe-Sb₂Te_S-Sbからなる寝膜を形 成し、さらにその上に೫電体層を形成し、さらに その勝電体層の上に反射層を形成してなることを

特徴とする特許請求の範囲第1項配載の光学情報 記錄再生消去部材。

- (5) Sb₂Te₃-GeTe-過剰Sbからなる容膜を、 熱伝導率の小なる ZnS と SiO₂ の混合体誘電体 層で、少くとも1方の面を接することを特徴とす る特許請求の範囲第1項記載の光学情報記録再生 消去部材。
- 3、発明の詳細な説明

産業上の利用分野

本発明は、レーザピーム等により、情報を、高 密度、大容量で記録再生,及び消去できる光学情 報配録再生消去部材に関するものである。

従来の技術

光ディスクメモリに関しては、TeとTeOっを主 成分とするTeOx (O<x<2.0) 薄膜を用いた追 記型のディスクがある。さらに、レーザ光により、 薄膜を加熱し、溶融し、急冷することにより、非 **晶質化し、情報を記録し又これを加熱し、徐帝す** るととにより結晶化し、前去することができる材 科としては、8.R.Ovehinsky(エス・アール・オ

プシンスキー)氏等の、カルコゲン材料 Ge 15 Te_{B1}Sb₂S₂ 等が知られている。又、Ae₂S₃ や、As₂Se₃ あるいは、Sb₂Se₃ 等カルコゲ ン元素と、周期律表第Ⅴ族あるいは、Ge等の第 ₩族元素等の組合せからたる薄膜等が広く知られ ている。とれらの薄膜化レーザ光で情報を記録し、 その情報を済去する方法としては、あらかじめ、 薄膜を結晶化させておき、これに≈ ø 1 μ皿に絞 ったレーザ光を、情報に応じて強度変調を施とし、 例えば、円盤状の配録ディスクを回転せしめて照 射し、とのレーザ光照射部位は、薄膜の融点以上 に昇盈し、かつ急冷し、非晶質化したドットとし て情報の配録が行える。との情報を消去するに際 しては、ディスクの回転トラック方向に長いスポ っト光を思射することにより、薄膜を加熱昇温さ せ、長いスポット光による徐冷効果によって再び、 結晶化させる方法が知られている。

発明が解決しよりとする問題点

薄膜を加熱昇温し、溶融急冷および、加熱昇温 徐冷等の手段を用いる情報記録および消去可能な

せてなる材料を選び、これを基板に形成してなる ことを特徴とする光学情報配録再生商去部材を提 供するものである。

作 用

Sb₂Te₃(融点 822で)は、薄膜化することにより、非晶質膜が得られ、非晶質化,結晶化の配録作用を有する。しかしながら、その無化(結晶化を伴う)温度は、~100℃と低く、熱的な安定性は低い。そこで、融点の高い Tm=726℃のGeTe を混合することにより、この無化(結晶化)温度を、180℃以上に上げることができる。この混合膜は、熱的安定性がすぐれるものの、加熱配録(非晶質化)消去(結晶化)あるいはその逆モードの配録消去のサイクルにおいて、信号品質の低下が発生しやすい。

そこで本発明では、過剰なSbを含ませて、 Sb₂Te₃-GeTe-Sbからなる混合体を用いることを特徴とするものである。この過剰なSbは、 結晶化、非晶質化の過程において、GeTe 成分と Sb₂Te₃成分の相分離に対する阻止効果を有し、 配母媒体においては、加熱サイクルに対応して、信号品質が変動する場合がある。 この変動要因としては、配録スポット光かよび、消去スポット光 による400℃以上の急速な加熱, 冷却の多数回のくりかえし刺放による基板材質の熱的機械的な損傷が生ずる場合もある。配録薄膜については、その構成組成によっては、膜中の組成,成分の場所的な変化いわゆる偏析が発生する場合もある。

基板あるいは、記録膜が、以上のような変化を 生じた場合、記録再生, 消去のサイクルにおいて、 ノイズの増大を生じ、サイクル特性の劣化が発生 するという問題点があった。

問題点を解決するための手段

本発明は、レーザ光等の照射により無的に輝度の状態を変化させて情報を記録および消去する部材において、記録と消去のサイクル特性を向上させることを目的として、薄膜材料として、GeTeと、Sb2Te3からなる混合体に過剰なSbを含ま

サイクルの向上をもたらす。同時化、結晶化化対 して、結晶化核のはたらきが期待でき、配録およ び、消去に対する感度向上をもたらす。

実 施 例

配録層である薄膜を形成する基板としては、あらかじめ、レーザ光案内薄を形成した樹脂基板を用い、この表面にあらかじめ耐熱性のすぐれた ZnS あるいは SiO2 等の無機勝電体層を形成 してかく。この誘電体層としては、SiO2 を 1 5 モルタ以上含ませた ZnS 勝電体層が好ましい。

この上に、Sb₂Te₃.GeTe および過剰Sbか ちなる混合薄膜を形成する。

解膜形成の方法としては、真空蒸着あるいは、スパッタ法が使用できる。この海膜の組成としては第1 図に示す Sb_2Te_3 , GeTe, かよび Sbからなる 3角ダイアグラムにおいて、A点 Sb_2Te_3 (3 8 %), GeTe(4 1 %), S b(2 4 %), B点 Sb_2Te_3 (27%), GeTe(51%), S b(22%). C点 Sb_2Te_3 (42%), GeTe(29%), S b(29%) を含む 領域 1 O中を選ぶことが 望まし

v.

とれを、Sb₂Te₃K対するそれぞれGeTeの 比かよび、過剰なSbの比で表わすと、 O.6<GeTe/Sb₂Te₃<2.0 かよび、 10<週剰Sb\$/Sb₂Te₃<30K選ぶことK なる。3角ダイアグラムにかいては、過剰Sb のモルダが約25ダのライン2を中心とする組成 領域になる。この25ダラインの組成点群が最も 虚要である。

第2図に、それぞれ膜の感度と組成の関係を示す。この図では、GeTe/Sb₂Te₃ ⇒1.2において、過剰Sb/Sb₂Te₃の値を、10,18,30のものについて示している。過剰Sbの増加に伴い、レーザパワー6mWの低パワー領域でのC/N比、曲線3は増大してゆき、感度の向上がみられる。ただしレーザパワー9mWでは曲線4に示すようにいずれの組成点においても、C/N比は、約55dBの値になっている。

GeTe/Sb₂Te₃の比が大きくなり、GeTe リッチになるほど、感度は低下する。さらにサイ

高感度化,サイクル特性安定化を同時に満足する 記録部材を得ることができる。

4、図面の簡単な説明

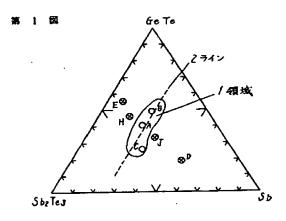
第1図は本発明の一実施例における光学情報配録再生消去部材に用いる配録薄膜の組成の3角ダイアグラム、第2図は同部材の配録感度(C/N比)の、過剰Sb/Sb₂Te₃比依存性を示す特性図である。

1 ……特性が良好な組成領域、2 …… Sb25%
 ライン、3 …… レーザパワー 6.8 mW における C/N
 比、4 …… レーザパワー 9 mW における C/N 比。
 代理人の氏名 弁理士 中 尾 散 男 ほか1名

クル特性と組成の関係は、サイクルに対するC/Nの変化量と 4C/Nとし、過剰 Sb/Sb₂Te₃の値について 4C/Nの大きさは、次の順序になる。
4C/N₁₀<4C/N₁₈≤4C/N₃₀となり、望ましくはSb/Sb₂Te₃>20に選ぶことが好ましい。第1図の3角ダイアグラムにおいて、Sb₂G参ラインよりも、過剰 Sbが少いポイント E, Hでは、サイクル特性の劣化が大きく、さらに、過剰 Sbが2 6 ララインよりも Sb 個つまり、多い領域のJ点ではサイクル特性の劣化が再び増大する。又、さらにSb が多い組成点D点では、配録感度, C/N比の低下が発生する。

発明の効果

レーザ光による記録再生消去する記録部材において、Gete-Sb₂Te₃ー過剰 Sb からなる組成の記録辞膜は、次の効果を有する。すなわち、薄膜中の安定合金の種類が減少するとともに、過剰 Sb のはたらきにより、記録・消去のサイクルにおける薄膜中の組成分離が生じにくくなり、サイクル特性が向上する。また、過剰 Sb の量により、



89 40
3
3
20
10 20 30 40
+56 455 562 Tes (molt)

第 2 図